

2011年全国化学与光谱分析会议在成都隆重召开

由中国机械工程学会理化检验分会主办，上海材料研究所承办的2011年全国化学与光谱分析会议于2011年7月29日~8月2日在成都心族宾馆隆重召开。

本次会议收到论文60余篇，来自全国各地的光谱分析专家、学者与技术人员共约80人参加了会议。会议由中国机械工程学会理化检验分会总干事、上海材料研究所检测中心副主任陶美娟高工主持，四川省机械工程学会理化检验分会理事长、四川机械设计研究院副总工程师申卫东教授首先致欢迎词，中国机械工程学会理化检验分会主任委员、上海材料研究所副所长鄢国强教授作了重要讲话，中国机械工程学会理化检验分会副主任委员、湖南大学化学化工学院吴海龙教授在主席台就座。我国著名光谱学家和化学家、我国原子光谱分析领域的第一位博士生导师和第一位博士后指导教师、厦门大学教授黄本立院士发来贺信并祝大会取得圆满成功。

本次学术会议特别邀请了武汉钢铁（集团）公司研究院资深专家曹宏燕教授做“测量结果的准确度和分析方法的评价”、中科院上海有机化学研究所郭寅龙教授做“有机小分子化合物的质谱学研究”、湖南大学吴海龙教授做“复杂化学体系定量分析理论研究进展”及上海材料研究所马冲先教授做“HG-AFS及其在金属材料痕量元素分析中的最新进展”等特邀报告，与会代表受益匪浅，对化学与光谱分析的发展动态有了新的全面的了解和认识。会议还进行了论文交流、国内外仪器厂商的光谱分析检测新仪器与新技术介绍。会议学术气氛相当浓厚，对光谱分析过程中共同关心的问题进行了热烈而又有益的探讨。

本次大会得到了各级学会和有关单位的大力支持，特别是上海材料研究所、四川机械设计研究院、珀金埃尔默仪器（上海）有限公司、安东帕（上海）商贸有限公司以及无锡英之诚高速分析仪器有限公司的大力协助和支持。在会议举办期间得到了四川机械设计研究院检测中心的全力支持，大会组委会向上述单位表示衷心的感谢！

通过本次大会，增进了代表之间的友谊与沟通，提供了通力合作的大好机会。与会代表建议今后多举行此类会议。

